

## 研究成果（小テーマにつき2ページ以内でまとめてください）

サブテーマ名：（3 保護膜低温形成技術の開発） 小テーマ名：（3-1、3-2 保護膜低温形成技術の開発）															
サブテマリーダー（所属、役職、氏名） 高知工科大学 総合研究所 教授 平尾 孝 研究従事者（所属、役職、氏名） 高知工科大学 総合研究所 講師 古田 寛 誠南工業（株） 専務取締役 亀井 龍一郎 誠南工業（株） 技術顧問 山下 睦夫  ( ) 平成17年3月末時点の所属・役職等															
研究の概要、新規性及び目標 研究の概要 プラスチック液晶、電子ペーパー、フレキシブル有機EL等の次世代ディスプレイに用いる有機基板上に形成されるTFTデバイスの信頼性確保のための保護膜を低温形成する装置技術やプロセス技術を開発する。また、プラスチック基板上に耐水性を有する保護膜を室温形成する装置やプロセス技術を開発する。 研究の独自性・新規性  研究の目標（フェーズ毎に数値目標等をあげ、具体的に）															
研究の進め方及び進捗状況（目標と対比して） フェーズ：研究（共同研究）実施期間は平成15年1月～平成17年3月。 研究の重点化を図るべきという中間評価における指摘事項を踏まえて研究テーマの再編を行なった結果、「保護膜低温形成技術の開発」は「ZnO-TFT技術の開発」に含めることとし、研究テーマからは除外した。 フェーズ：															
主な成果  特許件数：0件 査読論文数：0件 口頭発表件数：0件															
研究成果に関する評価 1．国内外における水準との対比  2．実用化に向けた波及効果															
残された課題と対応方針について															
	JST負担分（千円）							地域負担分（千円）							合計
	H 14	H 15	H 16	H 17	H 18	H 19	小計	H 14	H 15	H 16	H 17	H 18	H 19	小計	
人件費	0	324	170	-	-	-	494	1,000	102	171	-	-	-	1,273	1,767
設備費	0	4,861	19	-	-	-	4,880	789	9,194	222	-	-	-	10,205	15,085
その他研究費 （消耗品費、 材料費等）	0	0	424	-	-	-	424	1,307	59	247	-	-	-	1,613	2,037
旅費	0	121	70	-	-	-	191	0	0	0	-	-	-	0	191
その他	0	3	30	-	-	-	33	0	0	0	-	-	-	0	33
小 計	0	5,309	713	-	-	-	6,022	3,096	9,355	640	-	-	-	13,091	19,113
代表的な設備名と仕様〔既存（事業開始前）の設備含む〕 JST負担による設備：高出力パルス電源、パルス放電電極 地域負担による設備：															

複数の研究課題に共通した経費については按分する。